

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 2 区分

【発行日】平成 21 年 1 月 22 日 (2009.1.22)

【公表番号】特表 2008-521811 (P2008-521811A)

【公表日】平成 20 年 6 月 26 日 (2008.6.26)

【年通号数】公開・登録公報 2008-025

【出願番号】特願 2007-543395 (P2007-543395)

【国際特許分類】

C 0 7 D 401/04 (2006.01)

C 0 7 F 1/10 (2006.01)

【 F I 】

C 0 7 D 401/04 C S P

C 0 7 F 1/10 Z N M

【手続補正書】

【提出日】平成 20 年 11 月 12 日 (2008.11.12)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

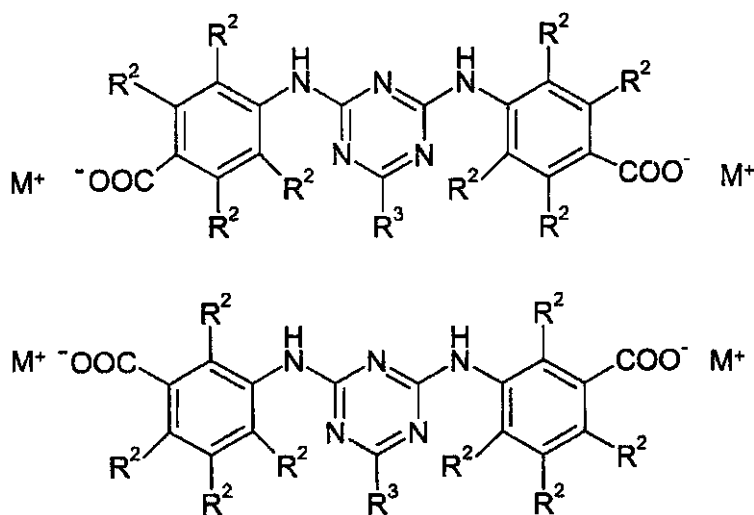
【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

以下の一般構造：

【化 1】



(式中、

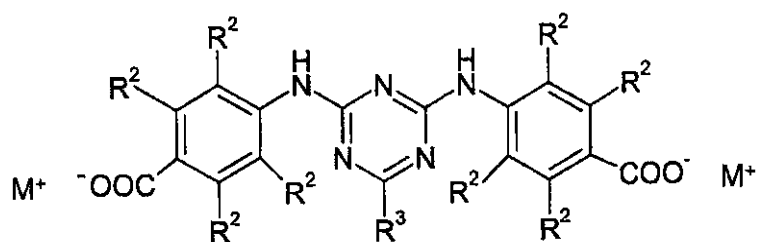
各 R^2 が、電子供与基、電子求引基および電子中性基からなる群から独立して選択され

、 R^3 が、置換および非置換の芳香族複素環ならびに置換および非置換の複素環からなる群から選択され、前記環が、 R^3 の環内の窒素原子を介してトリアジン基に結合し、そして

M^+ が、貴金属カチオンまたは遷移金属カチオンである)

【請求項 2】

【化 2】



【 請 求 項 3 】

(a) 請求項 1 に記載の化合物を含む溶液を基材の表面に適用する工程と、 (b) 該金属を還元する工程とを含む、配向金属性ナノ構造の生成方法。